Original document

# SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Patent number:

JP2003086761

Also published as:

Publication date:

2003-03-20

JP2003086761 (A)

Inventor:

TAWARA IWAO; NEGISHI YUJI; WAKIZAKA SHINJI

Applicant:

CASIO COMPUT CO LTD;; OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L25/065; H01L21/56; H01L25/07; H01L25/18

- european:

Application number: JP20010279062 20010914

Priority number(s):

View INPADOC patent family

#### Abstract of JP2003086761

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device together with its manufacturing method capable of high-density mounting, with no degradation in manufacturing yield or reliability. SOLUTION: There are provided a flexible substrate 1a, and a rigid flex substrate 1 comprising a rigid substrate 1b which clamps the substrate 1a on both surfaces. An external connection terminal 3 is formed on one rigid substrate 1b while a semiconductor chip 2 is mounted on other rigid substrates 1b. With a flexible part 1c comprising the flexible substrate 1a bent, the semiconductor chips 2 mounted on the rigid substrates 1b are laminated and resin-sealed, to provide a reliable semiconductor substrate excellent in moisture-resistance. Using the rigid flex substrate 1 eliminates deflection or twisting of substrate, to prevent dislocation at chip mounting for the improved manufacturing yield.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-86761 (P2003-86761A)

(43)公開日 平成15年3月20日(2003.3.20)

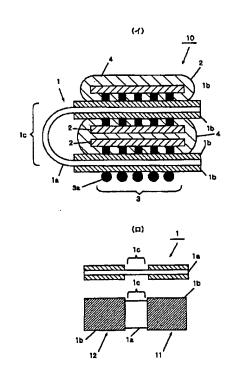
(51) Int.Cl.7 H 0 1 L	25/065 21/56 25/07	歲別記号	FI H01L 21	デーマコート*(参考) 1/56 R 5 F 0 6 1 T 5/08 Z
	25/18		審査請求	未請求 請求項の数11 OL (全 12 頁)
(21)出顯番号		特願2001-279062(P2001-279062)	(71)出願人	000001443 カシオ計算機株式会社
		平成13年9月14日(2001.9.14)	(71) 出願人	東京都渋谷区本町1丁目6番2号 000000295 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
			(72)発明者	田原 伊和男 東京都八王子市東浅川町550番地の1 株 式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ 内
			(74)代理人	100096699 弁理士 鹿嶋 英實
				最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

#### (57)【要約】

【課題】 製造歩留りの低下や信頼性を損うこと無く高密度実装することができる半導体装置およびその製造方法を実現する。

【解決手段】 フレキシブル基板1aと、この基板1aの両面を挟み込むリジッド基板1bを備えるリジッドフレックス基板1を備え、1つのリジッド基板1bに外部接続端子3が形成され、他の各リジッド基板1bに半導体チップ2が実装されて、フレキシブル基板1aからなる可撓部1cで屈曲させて各リジッド基板1bにそれぞれ実装される各半導体チップ2を積層させて樹脂封止するので、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置を実現できる。また、リジッドフレックス基板1を用いることで基板の撓みや捩れがなくなり、チップ実装時の位置ずれを防ぎ、製造歩留りを向上させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 屈曲自在なフレキシブル基板と、このフ レキシブル基板の第1の領域の両面を挟み込む2枚のリ ジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前記フレ キシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、少なく とも一方の面上に配設されるリジッド基板を備える第2 のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス 基板を備え、

前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド基板 部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジッド 基板上に、少なくとも1つの第1の半導体チップが実装 され、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基 板上に外部接続端子が形成され、前記第2のリジッド基 板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つの第2の半 導体チップが実装されていることを特徴とする半導体装

【請求項2】 前記リジッドフレックス基板の前記第1 のリジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記 フレキシブル基板を可撓部とし、該可撓部が屈曲され て、前記第1のリジッド基板部の一方のリジッド基板に 20 実装されている前記第1の半導体チップと、前記第2の リジッド基板部のリジッド基板に実装されている前記第 2の半導体チップとが積層され、樹脂封止されていると とを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 前記各リジッド基板にそれぞれ実装され る各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウェ ハレベルCSP構造を有することを特徴とする請求項1 または請求項2記載の半導体装置。

【請求項4】 前記可撓部の屈曲に応じて対向する前記 各リジット基板の内、前記第1のリジッド基板部の各リ ジッド基板の大きさを前記第2のリジッド基板部のリジ ッド基板の大きさより大きくしたことを特徴とする請求 項2記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 前記リジッドフレックス基板において、 前記可撓部が2箇所以上形成され、該可撓部を介して、 前記第2のリジッド基板部が前記第1のリジッド基板部 に対して従属的に2箇所以上形成され、前記可撓部が屈 曲されて、前記各リジット基板部の各リジッド基板に実 装される各半導体チップが順次折畳まれるように積層さ れることを特徴とする請求項2記載の半導体装置。

【請求項6】 前記リジッドフレックス基板において、 前記可撓部が前記第1のリジッド基板部の少なくとも2 辺に形成され、該可撓部を介して、前記第2のリジッド 基板部が前記第1のリジッド基板部に対して少なくとも 2方向に形成され、前記可撓部が屈曲されて、前記各リ ジッド基板部の各リジッド基板に実装される各半導体チ ップが前記第1のリジット基板部上で順次折畳まれるよ うに積層されることを特徴とする請求項2記載の半導体 装置。

続端子が形成される他方のリジッド基板には外部接続端 子形成用の端子バッドおよび配線パターンが形成され、 前記各半導体チップが実装される一方のリジッド基板、 および前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板に は前記半導体チップ実装用の接続端子パッドおよび配線 バターンが形成され、前記フレキシブル基板には所定の 配線パターンが形成されて、

前記各リジッド基板部の各リジッド基板の前記端子パッ ドおよび接続端子パッドが前記フレキシブル基板の前記 配線パターンを介して相互に電気的に接続されていると とを特徴とする請求項1乃6記載の半導体装置。

【請求項8】 屈曲自在なフレキシブル基板と、このフ レキシブル基板の1つの第1の領域の両面を挟み込む2 枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前 記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、 少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備え る第2のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレ ックス基板を複数連結したシート状の集合基板を用い、 前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板におけ る、前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド 基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジ ッド基板上に、少なくとも1つの第1の半導体チップを 実装するとともに、前記第2のリジッド基板部の前記リ ジッド基板に、少なくとも1つの第2の半導体チップを 実装する半導体チップ実装工程と、前記集合基板の前記 各リジッドフレックス基板における、前記第1のリジッ ド基板部の、他方のリジッド基板上に外部接続端子を形 成する外部接続端子形成工程と、

前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子形成 工程後、前記集合基板に連結された前記各リジッドフレ ックス基板を個片化する個片化工程と、

個片化された前記各リジッドフレックス基板を、該リジ ッドフレックス基板の前記第1のリジッド基板部と前記 第2のリジッド基板部間の前記フレキシブル基板を可撓 部として、該可撓部で屈曲させて前記各リジッド基板に 実装される前記各半導体チップを積層させて樹脂封止す る封止工程と、

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。 【請求項9】 屈曲自在なフレキシブル基板と、このフ 40 レキシブル基板の1つの第1の領域の両面を挟み込む2 枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基板部と、前 記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2の領域の、 少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備え る第2のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレ ックス基板を複数連結したシート状の集合基板を用い、 前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板におけ る、前記第1のリジッド基板部の、前記第2のリジッド 基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジ ッド基板上に、少なくとも1つの第1の半導体チップを 【請求項7】 前記第1のリジッド基板部の前記外部接 50 実装するとともに、前記第2のリジッド基板部の前記リ

ジッド基板に、少なくとも1つの第2の半導体チップを 実装する半導体チップ実装工程と、

前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板におけ る、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基板 上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程と、 前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子形成 工程後、前記集合基板上の前記各リジッドフレックス基 板において、前記第1のリジッド基板部を集合基板に連 結させたまま、前記第2のリジッド基板部の前記リジッ ド基板を当該集合基板から裁断して分離する分離工程

前記各リジッドフレックス基板の前記第1のリジッド基 板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキシブル 基板を可撓部として、前記第2のリジッド基板部が前記 集合基板から分離された状態の前記各リジッドフレック ス基板を、前記可撓部でそれぞれ屈曲させて前記各リジ ッド基板に実装される前記各半導体チップを積層し、そ の状態で上下に対向する半導体チップ同士を接着固定し てなるモジュールを一括して樹脂モールドした後、前記 第1のリジッド基板部の前記各リジット基板を集合基板 20 から裁断してモジュール単位に個片化するモジュール形 成工程と、

を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】 前記各リジッド基板にそれぞれ実装さ れる各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウ ェハレベルCSP構造を有することを特徴とする請求項 8 又は請求項9 のいずれかに記載の半導体装置の製造方

【請求項11】 前記モジュール形成工程では、上下に 対向する半導体チップ同士が接着固定された複数のモジ 30 ュールを個々に覆う金型を用い、これにより全モジュー ルを一括して樹脂モールドすることを特徴とする請求項 9記載の半導体装置の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複数の半導体チッ ブを高密度実装する半導体装置およびその製造方法に関 する。

[0002]

ップを髙密度実装するマルチチップモジュールが知られ ている。この種の技術として、例えば特開2000-3 07037号公報には、図10(イ)~(ハ)に図示す るように、可撓性を有するフレキシブル基板100上 に、バンプ101を介して2つの半導体チップ102. 102をフリップチップ実装し、その後にフレキシブル 基板100を屈曲させて両チップ102、102の背面 同士を当接させた状態で接着固定して積層し、屈曲させ たフレキシブル基板100の接続バッド103に形成さ れるハンダボール104を介して配線基板に接続するよ 50 る。

うにしたマルチチップモジュールが開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、こうしたマ ルチチップモジュール構造の半導体装置では、可撓性の フレキシブル基板100を使用しているので、当該基板 100に撓みや捩れが生じ易い。この為、汎用のチップ マウンタや基板搬送システムに適用し難い弊害や、とり わけ半導体チップ102をフェイスダウンで実装する際 に位置ずれが起こり易くなる結果、製造歩留りの低下を 招致するという問題がある。

【0004】また、上述のモジュール構造では、フレキ シブル基板100の屈曲により積層される半導体チップ 102の裏面同士が接着固定されるだけであって、さら にチップ周辺は露出状態にあるから耐湿性に欠け、信頼 性低下を招致するという問題もある。

【0005】そこで本発明は、このような事情に鑑みて なされたもので、汎用のチップマウンタや基板搬送シス テムに適用できる上、製造歩留りの低下や信頼性を損う こと無く高密度実装することができる半導体装置および その製造方法を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1に記載の発明では、屈曲自在なフレキシブ ル基板と、このフレキシブル基板の第1の領域の両面を 挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド基 板部と、前記フレキシブル基板の少なくとも1つの第2 の領域の、少なくとも一方の面上に配設されるリジッド 基板を備える第2のリジッド基板部とから構成されるリ ジッドフレックス基板を備え、前記第1のリジッド基板 部の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド 基板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1 つの第1の半導体チップが実装され、前記第1のリジッ ド基板部の、他方のリジッド基板上に外部接続端子が形 成され、前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板 に、少なくとも1つの第2の半導体チップが実装されて いることを特徴とする。

【0007】上記請求項1に従属する請求項2に記載の 発明では、前記リジッドフレックス基板の前記第1のリ ジッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレ 【従来の技術】近年、中間基板を用いて複数の半導体チ 40 キシブル基板を可撓部とし、該可撓部が屈曲されて、前 記第1のリジッド基板部の一方のリジッド基板に実装さ れている前記第1の半導体チップと、前記第2のリジッ ド基板部のリジッド基板に実装されている前記第2の半 導体チップとが積層され、樹脂封止されていることを特 徴とする。

> 【0008】上記請求項1または請求項2に従属する請 求項3に記載の発明では、前記各リジッド基板にそれぞ れ実装される各半導体チップは、突起電極を介して接続 されるウェハレベルCSP構造を有することを特徴とす

【0009】上記請求項1に従属する請求項4に記載の 発明では、前記可撓部の屈曲に応じて対向する前記各リ ジット基板の内、前記第1のリジッド基板部の各リジッ ド基板の大きさを前記第2のリジッド基板部のリジッド 基板の大きさより大きくしたことを特徴とする。

【0010】上記請求項1に従属する請求項5に記載の 発明では、前記リジッドフレックス基板において、前記 可撓部が2箇所以上形成され、該可撓部を介して、前記 第2のリジッド基板部が前記第1のリジッド基板部に対 して従属的に2箇所以上形成され、前記可撓部が屈曲さ れて、前記各リジット基板部の各リジッド基板に実装さ れる各半導体チップが順次折畳まれるように積層される ことを特徴とする。

【0011】上記請求項2に従属する請求項6に記載の 発明では、前記リジッドフレックス基板において、前記 可撓部が前記第1のリジッド基板部の少なくとも2辺に 形成され、該可撓部を介して、前記第2のリジッド基板 部が前記第1のリジッド基板部に対して少なくとも2方 向に形成され、前記可撓部が屈曲されて、前記各リジッ が前記第1のリジット基板部上で順次折畳まれるように 積層されることを特徴とする。

【0012】請求項1乃至6に従属する請求項7に記載 の発明では、前記第1のリジッド基板部の前記外部接続 端子が形成される他方のリジッド基板には外部接続端子 形成用の端子パッドおよび配線パターンが形成され、前 記各半導体チップが実装される一方のリジッド基板、お よび前記第2のリジッド基板部の前記リジッド基板には 前記半導体チップ実装用の接続端子パッドおよび配線パ 線パターンが形成されて、前記各リジッド基板部の各リ ジッド基板の前記端子パッドおよび接続端子パッドが前 記フレキシブル基板の前記配線パターンを介して相互に 電気的に接続されていることを特徴とする。

【0013】請求項8に記載の発明では、屈曲自在なフ レキシブル基板と、このフレキシブル基板の1つの第1 の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第 1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なく とも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設 されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とか 40 ら構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシ ート状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッ ドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部 の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基 板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも 1 つ の第1の半導体チップを実装するとともに、前記第2の リジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つ の第2の半導体チップを実装する半導体チップ実装工程 と、前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板にお

板上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程 と、前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子 形成工程後、前記集合基板に連結された前記各リジッド フレックス基板を個片化する個片化工程と、個片化され た前記各リジッドフレックス基板を、該リジッドフレッ クス基板の前記第1のリジッド基板部と前記第2のリジ ッド基板部間の前記フレキシブル基板を可撓部として、 該可撓部で屈曲させて前記各リジッド基板に実装される 前記各半導体チップを積層させて樹脂封止する封止工程 とを具備することを特徴とする。

【0014】請求項9に記載の発明では、屈曲自在なフ レキシブル基板と、このフレキシブル基板の1つの第1 の領域の両面を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第 1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少なく とも1つの第2の領域の、少なくとも一方の面上に配設 されるリジッド基板を備える第2のリジッド基板部とか ら構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシ ート状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッ ドフレックス基板における、前記第1のリジッド基板部 ド基板部の各リジッド基板に実装される各半導体チップ 20 の、前記第2のリジッド基板部における前記リジッド基 板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも1つ の第1の半導体チップを実装するとともに、前記第2の リジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも1つ の第2の半導体チップを実装する半導体チップ実装工程 と、前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板にお ける、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基 板上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程 と、前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子 形成工程後、前記集合基板上の前記各リジッドフレック ターンが形成され、前記フレキシブル基板には所定の配 30 ス基板において、前記第1のリジッド基板部を集合基板 に連結させたまま、前記第2のリジッド基板部の前記り ジッド基板を当該集合基板から裁断して分離する分離工 程と、前記各リジッドフレックス基板の前記第1のリジ ッド基板部と前記第2のリジッド基板部間の前記フレキ シブル基板を可撓部として、前記第2のリジッド基板部 が前記集合基板から分離された状態の前記各リジッドフ レックス基板を、前記可撓部でそれぞれ屈曲させて前記 各リジッド基板に実装される前記各半導体チップを積層 し、その状態で上下に対向する半導体チップ同士を接着 固定してなるモジュールを一括して樹脂モールドした 後、前記第1のリジッド基板部の前記各リジット基板を 集合基板から裁断してモジュール単位に個片化するモジ ュール形成工程と、を具備することを特徴とする。

【0015】上記請求項8又は請求項9のいずれかに従 属する請求項10に記載の発明では、前記各リジッド基 板にそれぞれ実装される各半導体チップは、突起電極を 介して接続されるウェハレベルCSP構造を有すること を特徴とする。

【0016】上記請求項9に従属する請求項11に記載 ける、前記第1のリジッド基板部の、他方のリジッド基 50 の発明によれば、前記モジュール形成工程では、上下に

対向する半導体チップ同士が接着固定された複数のモジ ュールを個々に覆う金型を用い、これにより全モジュー ルを一括して樹脂モールドすることを特徴とする。

【0017】本発明による半導体装置では、リジッドフ レックス基板をフレキシブル基板からなる可撓部で屈曲 させて各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チ ップを積層させて樹脂封止する。これにより、積層され た各半導体チップが固定保持されつつ気密封止される 為、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置を実現で き、しかもリジッドフレックス基板を用いたことで、基 10 板の撓みや捩れがなくなる為、半導体チップ実装時の位 置ずれを防ぐことができる結果、製造歩留りの低下を回 避し得る。

【0018】また、本発明による半導体装置の製造方法 では、リジッドフレックス基板を複数連結したシート状 の集合基板を使用しているので、撓みや捩れが発生せ ず、これ故、汎用のチップマウンタや基板搬送システム に適用でき、しかも実装時の位置ずれも回避し得る結 果、製造歩留りの低下を防ぐ。さらに、集合基板には複 数のリジッドフレックス基板が配設される為、それら複 20 気的に接続されるように構成されている。 数のリジッドフレックス基板に一括して半導体チップ実 装、端子形成および樹脂封止するバッチ処理が実現し 得、特別な実装プロセスを用いずとも効率良くモジュー ル構造の半導体装置を製造することができ、製品コスト 低減に寄与し得るようになっている。

#### [0019]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態について説明する。

#### (1) 第1 実施例

#### ①半導体装置10の構造

図1(イ)は第1実施例による半導体装置10の構造を 示す断面図である。この図において、1はフレキシブル 基板1 a とリジッド基板1 b とから形成されるリジッド フレックス基板である。リジッドフレックス基板 1 は、 同図(ロ)に図示するように、フレキシブル基板1aと 複数のリジッド基板lbを備え、フレキシブル基板la の上下両面をリジッド基板 1 b で挟んだ所謂サンドイッ チ構造を成した部分と、フレキシブル基板laが露出さ れた部分(可撓部)1 cを有する複合基板である。

【0020】すなわち、リジッドフレックス基板1は、 フレキシブル基板1 a が露出する可撓部1 c で屈曲自在 となり、また可撓部1cを境にして、両側にリジッド基 板1bが上下両面に配設され、4面のリジッド基板1b を具備する。そして、可撓部1 c を境にした一方側の、 リジッド基板 1 bが上下両面に配設される部分(第1の リジッド基板部11)の一方のリジッド基板1bには、 例えばウェハレベルCSP構造の半導体チップ2がフェ イスダウンによりフリップチップ実装され、他方のリジ ッド基板1 bには格子状にハンダボール3 aを配設して 外部接続端子3が形成される。また、可撓部1 c を境に 50 なる為、チップ実装時の位置ずれを防ぐことができる結

した他方側の、リジッド基板1bが上下両面に配設され る部分 (第2のリジッド基板部12) の各リジッド基板 1 b には、同様に、例えばウェハレベルCSP構造の半 導体チップ2がフリップチップ実装される。

【0021】また、後述するように、第1のリジッド基 板部11の、一方の半導体チップ2がフリップチップ実 装される側のリジッド基板1b、及び第2のリジッド基 板部12の各リジッド基板1bには、半導体チップ実装 用の接続端子パッド、配線パターン及びフレキシブル基 板laに形成される配線パターンに接続されるスルーホ ール等が形成され、第1のリジッド基板部11の、他方 の外部接続端子3が形成されるリジッド基板1bには、 外部接続端子形成用の端子パッド及び配線パターン及び スルーホール等が形成される。

【0022】一方、フレキシブル基板1aには、リジッ ド基板lbに接続される配線パターンやスルーホール (あるいはビアホール)等が形成され、これらにより各 リジッド基板1bの端子パッドおよび接続端子パッドが フレキシブル基板1aの配線パターンを介して相互に電

【0023】なお、ここで半導体チップ2をウェハレベ ルCSP構造によるものとしたが、このウェハレベルC SP構造は、ウェハ状態で半導体チップ上に絶縁層を形 成した後、再配線層を形成し、次いで突起電極(ポスト 端子) による接続用電極端子を形成した後、チップ毎に 個片化して形成したものであり、半導体チップとほぼ同 じ大きさで、且つ突起電極(ポスト端子)による接続用 電極端子の配置を比較的自由に設定可能としたものであ る。従って、半導体チップ2をウェハレベルCSP構造 30 とした場合、後述する図2に示すように、リジッド基板 1 b に形成される半導体チップ実装用の接続端子パッド をマトリクス状に配置することができ、リジッド基板 1 bの大きさを小さくすることができる。ただし、本発明 における各実施形態において、半導体チップ2の構成は このウェハレベルCSP構造に限定されるものではな く、突起電極が形成された種々の構造による半導体チッ プを用いることができる。

【0024】こうしてチップ実装および端子形成された リジッドフレックス基板1は、可撓部1cで屈曲される 40 ことによって、各半導体チップ2を積層状態にする。こ の状態で上下に対向する半導体チップ2同士を接着固定 してから、リジッド基板1bとの接合部を覆うようにリ ジッド基板 1 b に実装される各半導体チップ2を封止樹 脂5 にて気密封止する構造を有する。

【0025】とのようなモジュール構造にすると、積層 状態の各半導体チップ2を固定保持しつつ気密封止し得 る為、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置10を実 現できる。しかも、リジッドフレックス基板1を用いた ことで、基板の撓みや捩れが大きく低減され、殆どなく

果、製造歩留りを向上させることができる。また、リジ ッドフレックス基板1を用いると、半導体チップ2をフ リップチップ実装する面が3面となり、フレキシブル基 板100を用いた従来例(図10参照)に比べ、より高 密度実装し得るようになる。

【0026】なお、上記構成では、リジッドフレックス 基板1における第2のリジッド基板部もリジッド基板1 bが上下両面に配設される構成としたが、これに限るも のではなく、少なくとも第1のリジッド基板部において 半導体チップ2がフリップチップ実装される側のリジッ 10 ド基板1 b と同じ側にのみリジッド基板1 b を配設する 構成とし、そこに半導体チップ2をフリップチップ実装 するようにしてもよい。

#### 【0027】②半導体装置10の製造方法

次に、図2~図5を参照して上記構造による半導体装置 10の製造方法について説明する。第1実施例による製 造方法では、複数のリジッドフレックス基板 1 が連設し て形成されたシート状の集合基板20を用いる。図2

(イ) (ロ) に集合基板20の構成の一例を示す。この ート状基材21に4行3列のリジッドフレックス基板1 を一体的に連設して形成したものであり、図2(イ)は 集合基板20の平面形状を示し、図2(ロ)は集合基板 20の、リジッドフレックス基板1が形成された部分を 含む、A-A面での断面形状の要部を示す。

【0028】図に示す如く、複数のリジッドフレックス 基板 1 が形成される箇所においては、基材 2 1 をフレキ シブル基板 1 a として用い、これをリジッド基板 1 b で 上下に挟んで、上下のリジット基板1bとフレキシブル 基板1aとが一体化されるとともに、2つのリジット基 30 板1b配設領域間のフレキシブル基板1aを可撓部1c とする、前記図1におけるリジッドフレックス基板1と 同様の構成が複数連結して形成される。各連結部分に は、予め開口部(以下、ミシン目)22が、各リジッド フレックス基板1形成箇所の周囲に設けられている。と れにより、後述するように、このミシン目22に沿って 連結部分を裁断することで、容易に各リジッドフレック ス基板1を個片化し得るようになっている。

【0029】図2(ロ)に示す各リジッドフレックス基 板1において、図面上、右側のリジット基板1bとフレ 40 キシブル基板 1 a が一体化された部分を第 1 のリジッド 基板部11、左側のリジット基板1 b とフレキシブル基 板1aが一体化された部分を第2のリジッド基板部12 とした場合、ウェハレベルCSP構造による半導体チッ プが実装される、第1のリジッド基板部11の一方のリ ジッド基板 1 b、及び第2のリジッド基板部 1 2 の各リ ジッド基板1bには、例えば図2(イ)に示すようなマ トリクス状の接続端子パッド1dや配線パターン、及び 図2(ロ)に示すようなスルーホール1eが形成され、 また、外部接続端子3が形成される、第1のリジッド基 50 続端子パッド1d上)に、前記図3(イ)と同様にして

板部11の他方のリジッド基板1bには、外部接続端子 形成用の端子パッド1fや配線パターン及びスルーホー ル1eが形成される。

【0030】また、フレキシブル基板1aには配線バタ ーンlgが形成される。これらにより各リジッド基板1 bの接続端子パッド1dおよび端子パッド1fがフレキ シブル基板1aの配線パターン1gを介して相互に電気 的に接続されるように構成されている。また、図2

(イ) に示すように、基材21のリジッドフレックス基 板1形成領域外の周辺部分には、例えば銅箔からなるダ ミーパターン23が形成されている。このダミーパター ン23は、フレキシブル基板からなる基材21の剛性を 向上させ、撓みや捻れ等の変形を抑制して、製造工程に おいて汎用のチップマウンタや汎用の基板搬送システム を用いることができるようにするために設けられている ものである。但し、フレキシブル基板からなる基材21 のみで撓みや捻れ等が問題とならない場合は、ダミーパ ターン23を設けないようにしてもよい。

【0031】さて、このような集合基板20を用いて半 図に示す集合基板20は、フレキシブル基板からなるシ 20 導体装置10を製造する工程を以下に説明する。なお、 以下の各工程説明図においては、便宜上、第1のリジッ ド基板部11及び第2のリジッド基板部12を斜線部と して、単純化して示している。第1実施例の製造工程に おいては、まず図3(イ)に図示するように、集合基板 20の一面側にメタルマスクMMを載置し、その上にク リームハンダ21を供給して、スキージ22により印刷 することにより、同図(ロ)に示すように、各リジッド 基板 1 b の必要箇所(接続端子パッド 1 d 上)にクリー ムハンダ21を印刷する。

> 【0032】次いで、図4(イ)に示すように、ハンダ 印刷された箇所(接続端子パッド1d)に、図示しない チップマウンターにより、ウェハレベルCSP構造の半 導体チップ2を搭載する。次に、との状態で集合基板2 0をリフロー炉へ搬送してリフロー処理する。 これによ り、半導体チップ2がリジッド基板1bの各接続端子パ ッド1dにハンダ接合される。

【0033】 ことで、本発明による集合基板20は、フ レキシブル基板からなるものであるが、上記のように多 くのリジッド基板lbが載置された部分を備えるため、 従来のフレキシブル基板のように撓みや捩れが発生する ことが大幅に抑制される。この結果、汎用のチップマウ ンタを用いて半導体チップ2をフェイスダウンで位置決 め搭載したり、汎用の基板搬送システムにてリフロー炉 に搬送し得るようになる。

【0034】次いで、集合基板20に配設される各リジ ッドフレックス基板 1 の一面側に搭載された半導体チッ プ2についてリフローし終えた後、図4(ロ)に示すよ うに、集合基板20の向きを反転させ、第2のリジッド 基板部12の他面側のリジット基板1bの必要箇所(接 ハンダ印刷を施し、そとに半導体チップ2を搭載した 後、リフロー処理する。続いて、図4(ハ)に示すよう に、第1のリジッド基板部11の他面側の、外部接続端 子3が形成されるリジット基板1bに設けられた外部接 続端子形成用の端子パッド 1 f にフラックスを、例えば ピンにより転写して塗布した後、フラックスが塗布され

た各端子パッドにハンダボール3を搭載する。この後、

リフロー処理して外部接続端子3を形成する。

11

【0035】とうして半導体チップ2の実装および外部 接続端子3の形成が完了すると、同図(二)に示すよう に、基材21の各リジッドフレックス基板1形成箇所の 周囲に設けられているミシン目22(図2(イ)参照) に沿って基材21を裁断する。これにより、各リジッド フレックス基板1は、集合基板20からモジュール単位 で個片化される。なお、裁断には、例えばNCルーター 4を用いる。

【0036】次に、図5(イ)に図示するように、モジ ュール単位に個片化されたリジッドフレックス基板1の 第1のリジッド基板部11における、ハンダボール3に れる半導体チップ2上に、接着剤Sを塗布した後、同図 (ロ) に示すように、フレキシブル基板による可撓部1 cを屈曲させて各半導体チップ2を積層状態とする。 C の状態で上下に対向する半導体チップ2同士を接着固定 する。

【0037】そして、上下に対向する半導体チップ2同 士が接着固定された後、同図(ハ)に示すように、リジ ッド基板1 bに実装される各半導体チップ2 に封止樹脂 5 (例えばエポキシ樹脂)を、各半導体チップ2が完全 に覆われるまで塗布する。との際、例えばディスペンサ を用いてリジッド基板 1 b と半導体チップ 2 との接合部 分にも封止樹脂5が充填されるようポッティングする。 この後、封止樹脂5を熱硬化させる。これにより、図1 に図示した構造の半導体装置10が製造される。

【0038】とのように、第1実施例による製造方法に よれば、フレキシブル基板からなるシート状の基材21 に複数のリジッド基板 l b が載置された複数のリジッド フレックス基板1を一体的に連設した集合基板20を使 用しているので、従来のフレキシブル基板単体を用いた 場合のように撓みや捩れが発生することが大幅に抑制さ れ、殆どなくなる為、リジッド基板を用いる場合と同様 の汎用のチップマウンタや基板搬送システムを用いると とができる。しかも、半導体チップをフェイスダウンで リジッド基板にフリップチップ実装する形態として、リ ジッド基板はフレキシブル基板に比し、搭載部の平坦 度、寸法の安定性に優れるため、実装時の位置ずれも回 避し得る結果、製造歩留りを向上させることができる。 【0039】さらに、集合基板20には複数のリジッド フレックス基板 1 が配設される為、それら複数のリジッ ドフレックス基板1に一括してチップ実装および端子形 50 では、上述の第1実施例と同様、汎用のチップマウンタ

成するバッチ処理が実現し、特別な実装プロセスを用い ずとも効率良くモジュール構造の半導体装置10を製造 することができ、製品コスト低減に寄与し得る、という 効果も奏する。

【0040】(2)第2実施例

次に、図6~図7を参照して第2実施例について説明す る。なお、これらの図において、上述した第1実施例と 共通する要素には同一の番号を付している。上述の第1 実施例では、集合基板20の基材21をミシン目22に 沿って裁断して、形成された各リジッドフレックス基板 **1をモジュール単位に個片化し、個片化されたリジッド** フレックス基板 1 を可撓部 1 c で屈曲させて各半導体チ ップ2を積層し、その状態で上下に対向する半導体チッ ブ2同士を接着固定してからディスペンサによるポッテ ィングにより各半導体チップ2に樹脂封止する態様とし

【0041】とれに対し、第2実施例では、集合基板2 0に形成された各リジッドフレックス基板1において、 一方の第1のリジッド基板部11を集合基板20の基材 対向する側のリジット基板1bにフリップチップ実装さ 20 21に連結させたまま、他方の第2のリジッド基板部1 2をミシン目22で裁断して基材21から分離し、可撓 部1cを屈曲させて各半導体チップ2を積層し、上下に 対向する半導体チップ2同士を接着固定してから各半導 体チップ2を一括して樹脂モールドした後、個片化する ととを特徴としている。

> 【0042】すなわち、図6(イ)に図示するように、 上述の第1実施例と同様の実装プロセスによって集合基 板20に配設される各リジッドフレックス基板1に半導 体チップ2を実装するとともに、外部接続端子3を形成 30 する。次いで、同図(ロ)に示すように、各リジッドフ レックス基板部1の一方の、外部接続端子3が形成され る側の第1のリジッド基板部11を集合基板20の基材 21に連結させたまま、他方の第2のリジッド基板部1 2の周囲を、例えばNCルーター4によりミシン目22 で裁断して集合基板20の基材21から分離する。次い で、同図 (ハ) に示すように、可撓部1cを屈曲させて 各半導体チップ2を積層し、その状態で上下に対向する 半導体チップ2同士を接着固定する。

【0043】との後、同図(二)に示すように、トラン 40 ファモールド用の金型7を集合基板20上に装着し、エ ポキシ等のモールド樹脂材6を金型7のキャビティ部7 cに注入する。注入したモールド樹脂材を熱硬化させた 後、金型7を取り外すと、同図(ホ)に示すように、各 モジュールが一括して樹脂モールドされる。そして、各 リジッドフレックス基板1において、集合基板20の基 材21に連結させたままの第1のリジッド基板部11の 周囲をミシン目22に沿って裁断することで図7に図示 する構造の半導体装置10が形成される。

【0044】以上のように、第2実施例による製造方法

や基板搬送システムに適用可能であり、製造歩留りの低 下も防ぐことが出来る上、集合基板20上に形成される 複数のモジュールを一括して樹脂モールドする為、効率 良くモジュール構造の半導体装置10を製造し得るよう になり、製品コスト低減に寄与し得る。

13

【0045】なお、本実施例では、可撓部1cの屈曲に 応じて上下に対向し、下部側となる第1のリジッド基板 部11の各リジット基板1bと上部側となる第2のリジ ッド基板部11の各リジッド基板1bの寸法、形状を同 一のものとしていたが、これに替えて、下部側の各リジ 10 ット基板lbの大きさを上部側のそれより大きくするよ うにしてもよい。とのように、下部側のリジット基板1 bを上部側より大きくすると、トランスファーモールド に用いる金型7の形状を簡略化でき、しかも集合基板2 0への金型装着が容易になる、という利点が得られる。 【0046】(3)変形例

次に、図8~図9を参照して変形例について説明する。 上述した第1および第2実施例では、屈曲自在な可撓部 1 cを隔てて両側に1つの第1のリジッド基板部11と 1つの第2のリジッド基板部12を具備するリジッドフ レックス基板 1 を用いてマルチチップモジュールを形成 する構造例について言及したが、これに限らず、1つの 第1のリジッド基板部11を備えるとともに、複数の第 2のリジッド基板部12を複数の可撓部1cを介して連 結したリジッドフレックス基板 1 を用いてマルチチップ モジュールを形成することもできる。

【0047】例えば、図8(イ)に図示するように、下 面に外部接続端子3が形成される1つの第1のリジッド 基板部11と、3つの可撓部1c-1~1c-3を介し て縦続的に連結した3つの第2のリジッド基板部12を 備えるリジッドフレックス基板1を用い、これら可撓部 1 c-1~1 c-3を順番に屈曲させれば、同図(ロ) に示すように、各リジット基板1bにフリップチップ実 装される半導体チップ2が順次折畳まれるように積層さ れ、モールド樹脂材6で封止された、7層構造のマルチ チップモジュールを形成することができる。

【0048】また、図9(イ) および、そのB-B面で の断面図を示す同図 (ロ) に図示するように、下面に外 部接続端子3が形成される第1のリジッド基板部11の ジッド基板部12-1~12-4を連結したリジッドフ レックス基板1を用い、これら可撓部1c-1~1c-4を順番に屈曲させれば、同図(ハ)に示すように、各 リジッド基板1bにフリップチップ実装される各半導体 チップ2が順次折畳まれるように積層され、モールド樹 脂材6で封止された、9層構造のマルチチップモジュー ルを形成することができる。

[0049] この場合、第2のリジッド基板部12-1 ~12-4の各リジッド基板1bに実装される各半導体 線長を短縮することができるため、電気的特性を向上さ せることができる。また、上記各実施形態においては、 積層された各半導体チップ2を接着剤で固定し、その 後、封止樹脂5またはモールド樹脂6により封止を行う 構成としたが、これに限らず、例えば、積層された各半 導体チップ2を仮止め冶具でクリップして仮止めし、封 止樹脂5またはモールド樹脂6の硬化後、これを取り外 すようにしてもよい。さらに高密度実装する場合には、 例えば図8および図9に図示した折畳み形態を組合せる 等、様々なアレンジが可能であることは言うまでもな 41

[0050]

【発明の効果】請求項1に記載の発明によれば、屈曲自 在なフレキシブル基板と、とのフレキシブル基板の両面 を挟み込む2枚のリジッド基板を備える第1のリジッド 基板部と、フレキシブル基板の少なくとも一方の面上に 配設されるリジッド基板を備える少なくとも1つの第2 のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス 基板を備え、第1のリジッド基板部の一方のリジッド基 板および第2のリジッド基板部のリジッド基板上に半導 体チップが実装されて、第1のリジッド基板部の他方の リジッド基板上に外部接続端子が形成され、リジッド基 板を用いている為、基板の撓みや捩れがなくなり、チッ プ実装時の位置ずれを防ぐことができる結果、製造歩留 りを向上させることができる。請求項2に記載の発明に よれば、リジッドフレックス基板をフレキシブル基板か らなる可撓部で屈曲させて各リジッド基板にそれぞれ実 装される各半導体チップを積層させて樹脂封止するの で、積層された各半導体チップが固定保持されつつ気密 30 封止され、これにより耐湿性に優れた信頼性の高い半導 体装置を実現できる。請求項3に記載の発明によれば、 各リジッド基板に、突起電極を具備するウェハレベルC SP構造の半導体チップをフリップチップ実装するの で、高密度実装するととができる。請求項4に記載の発 明によれば、可撓部の屈曲に応じて上下に対向するリジ ット基板の内、下段側に位置するリジット基板を上段側 より大きくすると、トランスファーモールドに用いる金 型の形状を簡略化でき、しかも集合基板への金型装着が 容易になる、という利点が得られる。請求項5に記載の 周囲4辺に可撓部1c-1~1c-4を介して第2のリ 40 発明では、可撓部が2箇所以上形成され、該可撓部を介 して第2のリジッド基板部が第1のリジッド基板部に対 して従属的に2箇所以上形成されてなるリジッドフレッ クス基板を用い、これら可撓部が屈曲されて、各リジッ ト基板に実装される各半導体チップが順次折畳まれるよ うに積層されるので、髙密度実装することができる。請 求項6に記載の発明では、可撓部が第1のリジッド基板 部の少なくとも2辺に形成され、該可撓部を介して、第 2のリジッド基板部が第1のリジッド基板部に対して少 なくとも2方向に形成されたリジッドフレックス基板を チップ2と外部接続端子3との間の、可撓部を介する配 50 用い、これら可撓部が屈曲されて、各リジッド基板に実

16

15

装される各半導体チップが順次折畳まれるように積層さ れるので、高密度実装することができる。請求項7に記 載の発明によれば、リジッドフレックス基板における外 部接続端子が形成されるリジッド基板には外部接続端子 形成用の端子パッドおよび配線パターンが形成され、各 半導体チップが実装される各リジッド基板には半導体チ ップ実装用の接続端子バッドおよび配線バターンが形成 され、フレキシブル基板には所定の配線パターンが形成 されて、各リジッド基板の端子パッドおよび接続端子パ ッドがフレキシブル基板の配線パターンを介して相互に 10 ある。 電気的に接続されている為、各リジッド基板に実装され る各半導体チップと外部接続端子とが相互に電気的に接 続されたマルチチップモジュールを形成することができ る。請求項8、9に記載の発明によれば、マルチチップ モジュールの製造工程において、リジッドフレックス基 板を複数連結したシート状の集合基板を使用しているの で、撓みや捩れが発生せず、これ故、汎用のチップマウ ンタや基板搬送システムに適用でき、しかも実装時の位 置ずれも回避し得る結果、製造歩留りを向上させること ができる。さらに、集合基板には複数のリジッドフレッ 20 1 a フレキシブル基板 クス基板が配設される為、それら複数のリジッドフレッ クス基板に一括してチップ実装、端子形成および樹脂封 止するバッチ処理を実現し得、特別な実装プロセスを用 いずとも効率良くモジュール構造の半導体装置を製造す ることができ、製品コスト低減に寄与することができ る。請求項11に記載の発明によれば、上下に対向する 半導体チップ同士が接着固定された複数のモジュールを 個々に覆う金型を用い、これにより全モジュールを一括 して樹脂モールドするので、効率良くモジュール構造の 半導体装置を製造し得るようになり、製品コスト低減に 30 22 ミシン目 寄与するととができる。

#### \*【図面の簡単な説明】

【図1】第1実施例による半導体装置10の構造を示す 断面図である。

【図2】集合基板20の一例を示す平面図である。

【図3】第1実施例による半導体装置の製造工程を説明 するための断面図である。

【図4】図3に続く製造工程を説明するための断面図で

【図5】図4に続く製造工程を説明するための断面図で

【図6】第2実施例による半導体装置の製造工程を説明 するための断面図である。

【図7】第2実施例による半導体装置10の構造を示す 断面図である。

【図8】変形例を示す図である。

【図9】変形例を示す図である。

【図10】従来例を示す断面図である。

【符号の説明】

1 リジッドフレックス基板

1b リジッド基板

1 c 可撓部

2 半導体チップ

3 ハンダボール

5 封止樹脂

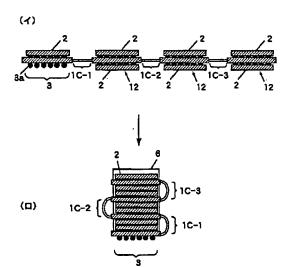
6 モールド樹脂材

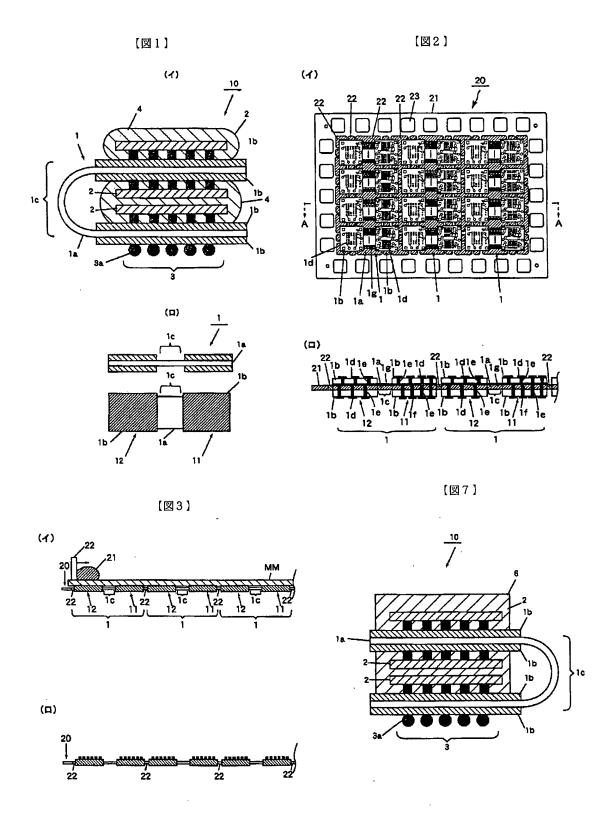
7 金型

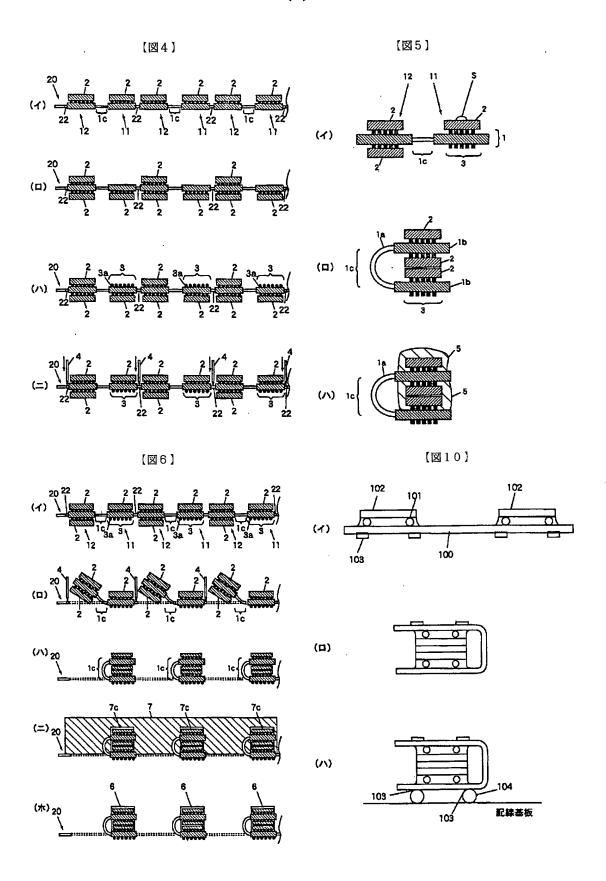
20 集合基板

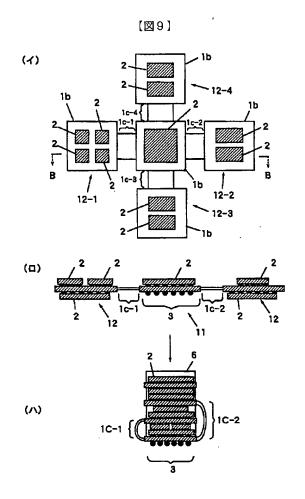
21 リジッド基材

[図8]









フロントページの続き

### (72)発明者 根岸 祐司

東京都八王子市東浅川町550番地の1 株式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ内

(72)発明者 脇坂 伸治

東京都八王子市東浅川町550番地の1 株式会社アイ・イー・ピー・テクノロジーズ内

Fターム(参考) 5F061 AA01 CA04 CA21

## This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: \_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.